

Pressemitteilung

13.12.2018

Erfolg auf führender Konferenz im Bereich Siliziummaterialien und-technologien in Japan

IHP-Wissenschaftler Dr. Dawid Kot mit dem Young Researcher Poster Award ausgezeichnet

Frankfurt (Oder). Dr. Dawid Kot vom IHP – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik erhielt den Young Researcher Poster Award beim "Forum on the Science and Technology of Silicon Materials 2018" in Okayama, Japan. Er wurde für seine Präsentation der gemeinsamen Publikation mit dem Münchner Unternehmen Siltronic zur Bildung von Komplexen von Gitterfehlstellen mit Sauerstoff bei sehr hohen Temperaturen, die er sowohl experimentell untersucht als auch theoretisch modelliert hat, ausgezeichnet. Siltronic zählt zu den führenden Anbietern von Siliziumwafern weltweit und seit vielen Jahren Kooperationspartner des IHP. Mit dem Preis werden drei Aspekte der Präsentation honoriert: die Publikation selbst, die mündliche Präsentation der Publikation und das Poster zu der Publikation. Die Preisträger wurden von führenden Wissenschaftlern ausgewählt.

Dawid Kot arbeitet seit 2007 am IHP und forscht im Bereich Defektkontrolle und Gettern von Siliziummaterialien. In diesem Bereich ist das vom 145. Komitee für die Verarbeitung und Charakterisierung von Kristallen der Japanischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft (JSPS) organisierte Forum eine der führenden Konferenzen weltweit und bringt internationale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie junge Forschende zu Siliziummaterialien alle vier Jahre zusammen. Das Gremium entwickelt neue Verarbeitungs- und Charakterisierungstechnologien und bietet Forschenden Foren zur Interaktion, um zu Verbesserungen in Bezug auf das Wachstum von Silizium- und Verbundhalbleiterkristallen und bei Wafertechnologien beizutragen.



innovations
for high
performance

microelectronics



Pressemitteilung



innovations
for high
performance
microelectronics



Prof. Dr. Koji Sueoka,
Vorsitzender des
Organisationskomitees
des Forums für
Wissenschaft und
Technologie von
Siliziummaterialien und
Dr. Dawid Kot vom IHP
(rechts) bei der
Preisverleihung in
Okayama, Japan.

© IHP 2018

Weiterführende Informationen:

JSPS: <http://www.jsps.go.jp/english/>

Forum: <http://www.ec.okayama-u.ac.jp/~dm/siforum/English/home.html>

Siltronic: <https://www.siltronic.com/de/>

Ansprechpartner:

Anne-Kristin Jentsch

Public Relations

IHP GmbH – Innovations for High Performance Microelectronics/

Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik

Im Technologiepark 25

15236 Frankfurt (Oder)

Fon: +49 (335) 5625 207

E-Mail: jentsch@ihp-microelectronics.com

Website: www.ihp-microelectronics.com

Über das IHP:

Das IHP ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft und betreibt Forschung und Entwicklung zu siliziumbasierten Systemen, Höchstfrequenz-Schaltungen und -Technologien einschließlich neuer Materialien. Es erarbeitet innovative Lösungen für Anwendungsbereiche wie die drahtlose und Breitbandkommunikation, Sicherheit, Medizintechnik, Industrie 4.0, Mobilität und Raumfahrt. Das IHP beschäftigt ca. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es verfügt über eine Pilotlinie für technologische Entwicklungen und die Präparation von Hochgeschwindigkeits-Schaltkreisen mit 0,13/0,25 µm-BiCMOS-Technologien, die sich in einem 1000 m² großen Reinraum der Klasse 1 befindet.

www.ihp-microelectronics.com

